## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2005 年4 月14 日 (14.04.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/033188 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C08J 5/18, C08L 71/10, C08K 3/00, B29C 47/88, G03G 15/00, 15/02, 15/16 // B29K 71:00, 105:16

Fukushima (JP). 鈴木 康浩 (SUZUKI, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工 業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014899

(74) 代理人: 西川 繁明 (NISHIKAWA, Shigeaki); 〒1160014 東京都荒川区東日暮里三丁目43番9号 ビジュア ル・シティー401号 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日:

2004年10月1日(01.10.2004)

(25) 国際出願の官語: 日本語

\_\_ . \_\_

(26) 国際公開の言語:

日本語

特願2003-346851 2003年10月6日(06.10.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 呉羽化 学工業株式会社(KUREHA CHEMICAL INDUSTRY COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1038552 東京都中 央区日本橋堀留町一丁目9番11号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 北村 秀樹 (KITAMURA, Hideki) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP). 寺本 嘉吉 (TERAMOTO, Yoshikichi) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP). 鈴木 和元 (SUZUKI, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP). 西畑 直光 (NISHIHATA, Naomitsu) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTIVE FILM, ELECTRIC CHARGE CONTROL MEMBER AND PROCESS FOR PRODUCING THE SEMICONDUCTIVE FILM

(54) 発明の名称: 半導電性フィルム、電荷制御部材、及び半導電性フィルムの製造方法

(57) Abstract: A semiconductive film from a resin composition comprising a polyether ether ketone and a conductive filler. The semiconductive film has an average thickness of 30 to 250  $\mu$  m, and the thickness maximum is in the range of 1 to 1.3 times the thickness minimum. The semiconductive film has an average volume resistivity of  $1.0 \times 10^2$  to  $1.0 \times 10^{14}$   $\Omega$  cm, and the volume resistivity maximum is in the range of 1 to 30 times the volume resistivity minimum. With respect to the semiconductive film, the number of reciprocating flexes measured by flexing resistance test is 5000 flexes or more. There is further provided a process for producing the same.

▼ (57) 要約: ポリエーテルエーテルケトンと導電性フィラーを含有する樹脂組成物から形成された半導電性フィルムであって、厚みの平均値が30~250μmかつ厚みの最大値が最小値の1~1.3倍であり、体積抵抗率の平均値が1.0×102~1.0×1014Ωcmかつ体積抵抗率の最大値が最小値の1~30倍であり、耐折強さ試験法により測定した往復折り曲げ回数が5,000回以上である半導電性フィルム、並びにその製造方法。



